

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 2 区分

【発行日】平成28年2月4日 (2016.2.4)

【公表番号】特表2015-509915(P2015-509915A)

【公表日】平成27年4月2日 (2015.4.2)

【年通号数】公開・登録公報2015-022

【出願番号】特願2014-549132(P2014-549132)

【国際特許分類】

A 0 1 N	3/00	(2006.01)
B 0 1 J	20/20	(2006.01)
B 0 1 J	20/18	(2006.01)
B 0 1 J	20/08	(2006.01)
B 0 1 J	20/06	(2006.01)
C 0 1 B	31/08	(2006.01)
C 0 1 B	13/14	(2006.01)
F 2 5 D	23/00	(2006.01)
A 0 1 N	3/02	(2006.01)
A 2 3 L	3/34	(2006.01)
A 2 3 B	7/00	(2006.01)
A 2 3 B	7/14	(2006.01)

【F I】

A 0 1 N	3/00	
B 0 1 J	20/20	B
B 0 1 J	20/18	B
B 0 1 J	20/08	A
B 0 1 J	20/08	C
B 0 1 J	20/06	A
C 0 1 B	31/08	Z
C 0 1 B	13/14	A
F 2 5 D	23/00	3 0 2 M
A 0 1 N	3/02	
A 2 3 L	3/34	
A 2 3 B	7/00	1 0 1
A 2 3 B	7/14	

【手続補正書】

【提出日】平成27年12月8日 (2015.12.8)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

フッ素化表面と、  
前記フッ素化表面上に配置された金ナノ粒子の不連続層と、  
を含む、複合粒子。

【請求項 2】

基材、及び

前記基材の表面上に配置されているか、前記基材内に配置されているか、又は両方の複数の複合粒子、

を含み、

前記複数の複合粒子における個々の複合粒子が、

フッ素化表面と、

前記フッ素化表面上に配置された金ナノ粒子の不連続層と、

を含む、物品。

【請求項 3】

容器、及び

前記容器内に配置された複数の複合粒子、

を含み、

前記複数の複合粒子における個々の複合粒子が、

フッ素化表面と、

前記フッ素化表面上に配置された金ナノ粒子の不連続層と、

を含む、物品。

【請求項 4】

エチレンを除去する方法であって、

エチレン発生源に近接してエチレン除去剤を配置するステップであって、前記エチレン除去剤が、

複数の複合粒子を含み、前記複数の複合粒子における個々の複合粒子が、

フッ素化表面と、

前記フッ素化表面上に配置された金ナノ粒子の不連続層と、

を含む、ステップを含む、方法。

【請求項 5】

請求項 1 に記載の複合粒子を備える、冷却システム。